

2004年11月17日

各 位

会 社 名 東京応化工業株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 中村洋一  
コード番号 4186 (東証第一部)  
問 合 せ 先 広報部  
TEL (044) 435 - 3000

## 最先端半導体製造用材料の研究開発棟新設に関するお知らせ

(次世代以降のフォトリソグラフィ技術の研究開発を強化)

東京応化工業株式会社(本社：川崎市中原区/社長：中村洋一)は、次世代以降の最先端半導体製造用材料に関する研究開発の一層の強化を目的として、新たな研究開発棟を相模事業所内に建設することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

この研究開発棟には、清浄度 ISOクラス 3.5 以下(注)のスーパークリーンルームを設置し、45nm ノードプロセス以降の微細加工に対応するフォトリソグラフィ技術に関連する研究開発を積極的に進めるため、最新鋭の研究開発機器を導入する計画であります。なお、第1期導入機器は、45nm ノードプロセスに必要な研究開発機器として、液浸露光技術に対応する露光装置等の導入を検討しております。

半導体製造プロセスではその微細化の進展に伴い様々な露光技術が検討されており、半導体製造用材料に対しても要求の高度化、多様化が進んでおります。今後、半導体分野で極微細な領域の研究開発を行うためには、清浄度等の環境が整ったクリーンルームを備えた設備と、最新鋭の研究開発機器が必要不可欠なものとなっております。

また、当社は、「微細加工技術の多角的展開」を積極的に推進し、多くの分野で微細加工技術の展開を図っております。中でも半導体分野での微細加工技術を、技術的な進歩を支えるドライビングフォースと考えており、本投資により設備、機器の整備を行うことで研究開発をさらに加速、強化し、微細加工技術の一層の深化を図ってまいりたい所存であります。

注 ISOクラス 3.5は、米国連邦規格ではクラス 10 (0.3 $\mu$ m)に相当します。これは、1立方フィートの空気中に0.3 $\mu$ m以上の浮遊物質が10個以下であることを意味しています。

1 / 2

---

本件に関するお問い合わせは

東京応化工業株式会社 広報部

〒211-0012 川崎市中原区中丸子150番地 TEL.044-435-3000(代) FAX.044-435-3020

<http://www.tok.co.jp/>

### 新研究開発棟の概要

- (1) 所在地 神奈川県高座郡寒川町田端1590番地（東京応化工業株式会社 相模事業所内）
- (2) 建築面積 約1,600㎡
- (3) 延べ床面積 約5,900㎡
- (4) 構造 鉄骨造 地上6階建て
- (5) 投資額 約65億円
- (6) 完成予定 2005年12月

### 完成予想図



以上